

半导体物理 B

Semiconductor Physics B

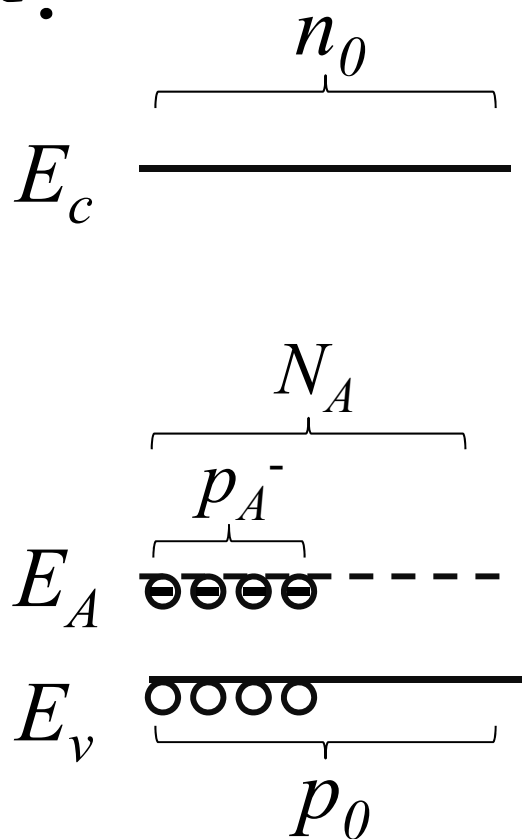
程骏骥

电子科技大学

思考题

试画出掺杂为 N_A 的p型半导体处于强电离区的电荷分布图，并求出其载流子浓度和费米能级。

答：



由电中性方程得： $p_0 = N_A$

再由质量作用定律得：

$$n_0 = n_i^2 / N_A$$

代入平衡载流子浓度方程

$$p_0 = N_v \cdot e^{-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}}$$

$$\text{得： } E_F = E_v - k_0 T \ln(N_A / N_v)$$

思考题

(1) 某Si中，每百万个Si原子掺有一个p型杂质原子，计算室温下材料中少数载流子的浓度。
(已知Si晶体的原子密度为 $4.96 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$)

思考题

$$\begin{aligned}\text{解: (1) } N_A &= (4.96 \times 10^{22}) \times 10^{-6} \\ &= 4.96 \times 10^{16} \text{ (cm}^{-3}\text{)} \gg 10n_i\end{aligned}$$

$$\text{所以 } p_0 \approx N_A = 4.96 \times 10^{16} \text{ (cm}^{-3}\text{)}$$

故少数载流子的浓度

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{4.96 \times 10^{16}} \cong 4.5 \times 10^3 \text{ (cm}^{-3}\text{)}$$

思考题

(1) 某Si中，每百万个Si原子掺有一个p型杂质原子，计算室温下材料中少数载流子的浓度。
(已知Si晶体的原子密度为 $4.96 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$)

(2) 温度升到573K时, $n_i \approx 3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, 设掺入的杂质浓度不变, 问此时半导体呈现什么导电性? 电子与空穴的浓度大致等于多少?

思考题

(2) 573K时,

由电中性条件: $n_0 + N_A = p_0$

及质量作用定律: $n_0 p_0 = n_i^2$

得到 $p_0 \approx ??? \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

所以 $n_0 = ??? \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

可见, $p_0 > n_0$

因此, 半导体仍呈现为p型导电性.

思考题

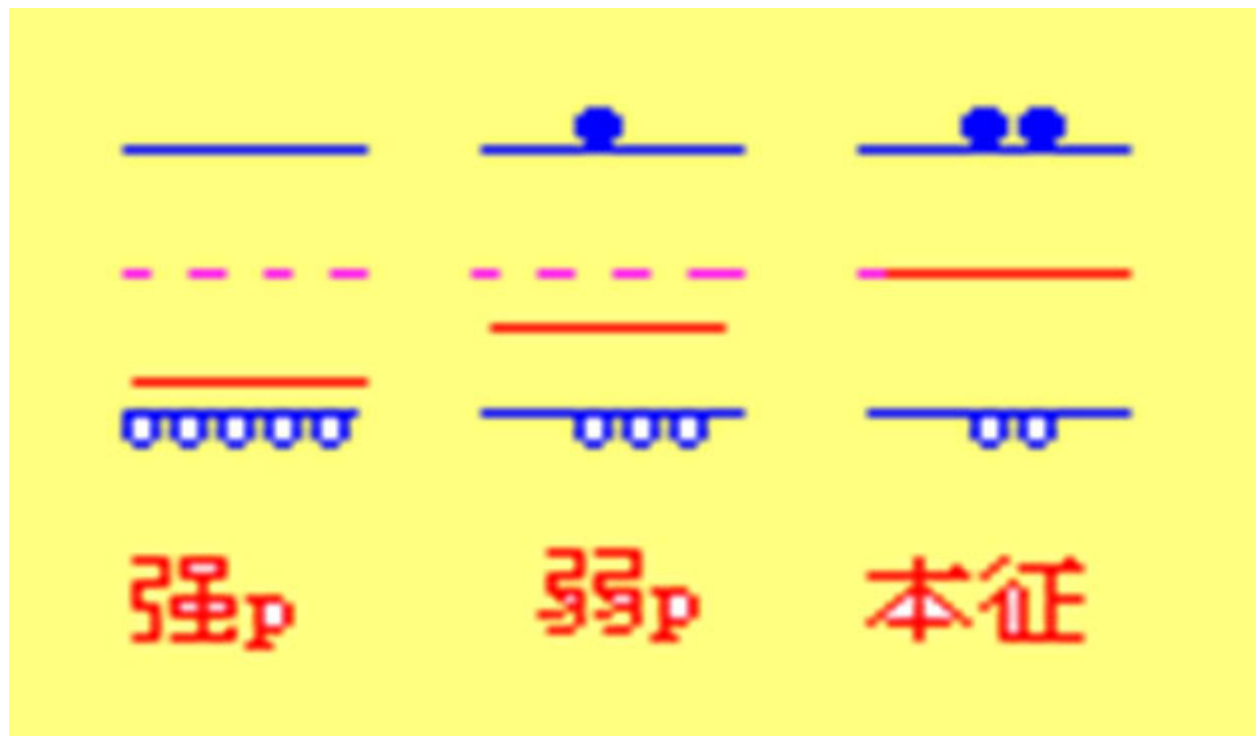
(1) 某Si中，每百万个Si原子掺有一个p型杂质原子，计算室温下材料中少数载流子的浓度。
(已知Si晶体的原子密度为 $4.96 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ ， $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$)

(2) 温度升到573K时， $n_i \approx 3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ，设掺入的杂质浓度不变，问此时半导体呈现什么导电性？电子与空穴的浓度大致等于多少？

(3) 画出室温下该p型Si的能带图，当杂质原子浓度增加时，费米能级将如何变化？

思考题

(3) 当杂质原子浓度增加时



杂质原子浓度增加

习题3

To calculate the thermal-equilibrium electron and hole concentration in a germanium sample with a given doping concentration.

Consider a germanium sample at $T = 300$ K in which $N_D = 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ and $N_A = 0$.

Assume that now $n_i = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$.

习题3

Solution:

$$\text{From } \begin{cases} n_0 = N_D + p_0 \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Then } n_0 &= \frac{N_D}{2} + \frac{\sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} \\ &= \frac{5 \times 10^{13}}{2} + \frac{\sqrt{(5 \times 10^{13})^2 + 4(2.4 \times 10^{13})^2}}{2} \\ &\approx 5.97 \times 10^{13} (\text{cm}^{-3}) \end{aligned}$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(2.4 \times 10^{13})^2}{5.97 \times 10^{13}} = 9.65 \times 10^{12} (\text{cm}^{-3})$$

习题4

To determine the required donor impurity concentration to obtain a specified E_F .

Silicon at $T=300$ K contains an acceptor impurity concentration of $N_A=10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Determine the concentration of donor impurity that must be added so that the silicon is n type and the Fermi energy is 0.20 eV below the conduction band edge.

$$N_c = 2.8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}.$$

Solution:

From

$$\begin{aligned}n_0 &= N_c \cdot e^{-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}} \\&= 2.8 \times 10^{19} \cdot \exp\left(-\frac{0.20}{0.0259}\right) \\&= 1.24 \times 10^{16} \left(\text{cm}^{-3}\right) \\&\gg n_i\end{aligned}$$

We have $N_D - N_A = n_0$

Then

$$N_D = 1.24 \times 10^{16} + N_A = 2.24 \times 10^{16} \left(\text{cm}^{-3}\right)$$

习题5

To determine the Fermi-level position and the maximum doping concentration at which the Boltzmann approximation is still valid.

Consider p-type **silicon**, at **T=300K**, doped with **boron**. We may assume that $E_A - E_V = 0.045$ eV and the limit of the Boltzmann approximation occurs when $E_F - E_A = 3k_0T$.

$$n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}.$$

•Solution:

If we assume that $E_{Fi} \approx E_i$,

from

$$N_A \approx p_0 = n_i \cdot e^{-\frac{E_F - E_i}{k_0 T}}$$

Then

$$\begin{aligned} N_A &= n_i \cdot e^{-\frac{E_F - E_i}{k_0 T}} \\ &= n_i \cdot e^{\frac{\frac{E_g}{2} - (E_A - E_v) - (E_F - E_A)}{k_0 T}} = \dots = \\ &= 3 \times 10^{17} \left(cm^{-3} \right) \end{aligned}$$

习题6

例：判断并予以修正、给出正确问题和答案：

- ✶ 为什么禁带宽度越宽，掺杂浓度越高，相应器件的极限工作温度就越高？
- ✶ 提示：如果掺杂使得半导体成为简并半导体，则掺杂浓度越高将导致禁带越窄。
- ✶ 一定温度的非简并半导体，禁带宽度越宽， n_i 越小，掺杂浓度越高， n_D^+ 或 n_A^- 越大，升高温度方可使 n_i 超过 n_D^+ 或 n_A^-

思考题

设两块n型硅的施主浓度分别为 $1.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 及 10^{12} cm^{-3} ，试分别计算它们500 K时的 n_0 与 p_0 。

已知500 K时Si的 $n_i = 3.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

解：

500 K时硅中施主已全部电离，故：

$$\begin{cases} n_0 = N_D + p_0 \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$$

例题

求解上述方程组，得：

$$\begin{cases} n_0 = \frac{N_D}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right) \\ p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \end{cases}$$

代入： $N_D = 1.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 和 $n_i = 3.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

得： $n_0 \approx 4.3 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $p_0 \approx 2.8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

差别已不明显

代入： $N_D = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 和 $n_i = 3.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

得： $n_0 = p_0 \approx 3.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 已到本征温区